

	Силабус навчальної дисципліни “Основи обробки матеріалів та одержання виробів з них”
Напрямок підготовки	Доктор філософії
Галузь знань	13 Механічна інженерія
Спеціальність	132 Матеріалознавство
Освітньо-наукова програма	«Монокристалічні, керамічні та наноструктурні матеріали»
Статус дисципліни	Нормативна
Семестр	4
Кількість кредитів ЄКТС	3
Форма підсумкового контролю	Залік
Викладач	Вовк Олена Олександрівна , кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник Інституту монокристалів Національної академії наук України CV: https://isc.kharkov.ua/wp-content/uploads/2023/01/cv_vovk.pdf e-mail: vovk@isc.kharkov.ua , ov2017@gmail.com Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7003399252 тел. роб.: 341-04-01
Анотація навчальної дисципліни	Знайомство з оптичними матеріалами та виробами з них, з основами обробки матеріалів, особливостями, умовами та механізмами основних етапів виготовлення оптичних деталей, основними та допоміжними матеріалами, інструментом та технологічним устаткуванням для обробки, основними характеристиками оптичних виробів та методами їх контролю.
Загальний обсяг	90 годин: лекції – 40 годин; практичні заняття – 10 годин; самостійна робота – 40 годин
Заплановані результати навчання	Згідно з вимогами освітньо-наукової програми аспіранти повинні досягти таких результатів навчання: <ul style="list-style-type: none"> - знати основні види оптичних матеріалів та їх фізико-хімічні властивості, основні етапи виготовлення оптичних елементів; - розуміти фізичні процеси, що відбуваються на різних етапах обробки; - вміти вибрати послідовність етапів виготовлення оптичних елементів для різних матеріалів; - знати основне обладнання, допоміжні матеріали та основні методи контролю за параметрами виробів.

Тематичний план навчальної дисципліни

Вступ. Інститут монокристалів, напрямки роботи. Оптичні матеріали, що виробляються в інституті та методи їх отримання. Виготовлення оптичних деталей.

Розділ 1. Види оптичних матеріалів, їх властивості та виготовлення оптичних деталей

- Тема 1. Оптичні матеріали, вироби з них.** Специфікація виробів. Види оптичних матеріалів. Оптичне скло, номенклатура оптичного скла. Скло для ІЧ-діапазону, для лазерних елементів, кварцове скло, сітали. Оптичні монокристали, для ІЧ-діапазону, для лазерної генерації. Оптичні полікристали (оптична кераміка).
- Тема 2. Оптичні деталі. Креслення.** Вимоги до матеріалу. Вимоги до точності виготовлення. Параметри оптичних деталей, що контролюються.
- Тема 3. Основні етапи обробки оптичних матеріалів.** Контроль якості матеріалу. Різання. Шліфування закріпленим та вільним абразивом. Механічне полірування, фінішне полірування. Взаємодія одиничного алмазного зерна з оброблюваною поверхнею при механічній обробці. Полірування: механічне, хіміко-механічне, хімічне. Обладнання.
- Тема 4. Абразивні матеріали та інструмент.** Класифікація абразивних матеріалів та їх основні параметри. Зернистість порошків абразивних матеріалів та їх позначення.. Алмазний інструмент. Шліфувальники, полірувальники. Допоміжні матеріали.
- Тема 5. Виготовлення оптичних деталей із скла.** Виготовлення заготовок, відпал. Шліфування зв'язаним та вільним абразивом. Суспензії для шліфування. Механічне полірування.
- Тема 6. Оптичні покриття та з'єднання оптичних деталей.** Методи нанесення, властивості. З'єднання оптичних деталей, оптичні клеї, з'єднання методом оптичного контакту.

Розділ 2. Обробка оптичних кристалічних матеріалів. Порушений приповерхневий шар: структура та методи дослідження. Виготовлення деталей з сапфіру.

- Тема 7. Оптичні кристалічні матеріали та особливості їх механічної обробки.** Основні фізико-механічні та фізико-хімічні властивості оптичних кристалічних матеріалів. Методи контролю якості кристалів. Кристалографічне орієнтування кристалів. Механічна обробка кристалів в залежності від мікротвердості. Механічна обробка оптичних кристалічних матеріалів з мікротвердістю більше 10^6 Па.
- Тема 8. Порушений приповерхневий шар при механічній обробці.** Причини його утворення та поетапне видалення. Структура порушеного приповерхневого шару. Еволюція поверхні в процесі обробки, шорсткість. Структурна досконалість поверхні, криві дифракційного відбиття.
- Тема 9. Сапфір та виготовлення деталей з сапфіру.** Фізичні властивості. Градації якості сапфіру. Конструкційний сапфір. Виготовлення оптичних вікон, підкладок. Кристалографічне орієнтування кристалів. Різання, шліфування. Механічне полірування, абразивні порошки, пасти. Хіміко-механічне полірування сапфіру, механізм. Полірувальні суспензії. Анізотропія полірування різних кристалографічних площин сапфіру, кутова анізотропія.. Одержання підкладок з сапфіру з терасно-ступінчатим рельєфом поверхні.. Атомно-силова мікроскопія в дослідженні поверхні.

Розділ 3. Виготовлення прецизійних елементів для лазерної техніки та вікон спецпризначення. Обробка кристалів з мікротвердістю менше 10^6 Па.

Тема 10. Обробка кристалів з мікротвердістю менше 10^6 Па. Обробка водорозчинних кристалів, напівпровідникових матеріалів. Механічне та хіміко-механічне полірування напівпровідникових матеріалів. Безконтактне полірування. Методи контролю основних параметрів. Особливості механічної обробки оптичної кераміки.

Тема 11. Виготовлення прецизійних елементів для лазерної техніки та вікон спецпризначення. Вимоги до технічних параметрів виробів: якість матеріалу, площинність, перпендикулярність, клин, оптична якість поверхні. Основні етапи технологічного процесу виготовлення елементів з сапфіру, гранатів, боратів, магній-алюмінієвої шпінелі. Особливості фінішного етапу полірування.

Структура навчальної дисципліни

Розділи і теми	Кількість годин			
	усього	у тому числі		
		лекції	практика	сам. роб.
1	2	3	4	5
Розділ 1				
Вступ		3		
Тема 1		4		4
Тема 2		5		4
Тема 3		5		5
Тема 4		6		5
Тема 5		3		3
Тема 6		2		2
Разом за розділом 1	51	28		23
Розділ 2				
Тема 7		1		1
Тема 8		1	5	1
Тема 9		6	5	5
Разом за розділом 2	25	8	10	7
Розділ 3				
Тема 10		2		2
Тема 11		2		2
Разом за розділом 3	8	4		4
Залік	6			6
Усього годин	90	40	10	40

Теми практичних занять

№	Назва теми	Кількість годин
П1	Виготовлення вікон та підкладок з сапфіру	5
П2	Дослідження поверхні методом атомно-силової мікроскопії	5

Разом													10			
Методи контролю																
Поточний контроль Перевірка розуміння аспірантами теоретичного та практичного програмного матеріалу в цілому, здатність творчо використовувати накопиченні знання та вміння. Підсумковий контроль (залік).																
Схема нарахування балів																
Поточний контроль, практичні роботи, самостійна робота														Залік	Сума	
Розділ 1						Розділ 2					Розділ 3		Разом			
T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	П1	П2	T10	T11				
4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	8	4	4	60	40	100	
Шкала оцінювання																
Сума балів за всі види навчальної діяльності протягом семестру								Оцінка								
90-100								Відмінно					Зараховано			
70-89								Добре								
50-69								Задовільно								
1-49								Незадовільно					Не зараховано			
Критерії оцінювання																
Шляхом усного опитування викладач перевіряє розуміння аспірантами теоретичного програмного матеріалу в цілому (оцінюється до 4 балів). Під час практичного заняття перевіряється здатність творчо використовувати накопиченні знання та вміння (оцінюється до 4 балів). Залік оцінюється за наступною системою балів:																
40 балів			аспірант продемонстрував глибоке знання змісту питання; відповідь побудована лаконічно, чітко, логічно та послідовно; відповідь демонструє високий рівень засвоєння навчального матеріалу													
30-39 балів			аспірант продемонстрував знання змісту питання; відповідь побудована лаконічно та послідовно, проте допущені певні неточності та похибки у логіці викладу матеріалу;													
20-29 балів			аспірант продемонстрував певне знання змісту питання, відповідь є недостатньо послідовною, та логічною;													
10-19 балів			аспірант продемонстрував уявлення з залікового питання, відповідь є фрагментарною, відповідь не послідовна, не логічна, не зовсім відповідає змісту питання													
1-20 балів			відповідь часткова; відповідь не послідовна, не логічна, не зовсім відповідає змісту питання.													
0 балів			відповідь відсутня, або не відповідає змісту питання													
Питання до заліку																

1. Оптичні матеріали та вироби з них. Специфікація виробів. Види оптичних матеріалів.
2. Оптичне скло, номенклатура оптичного скла. Скло для ІЧ-діапазону, для лазерних елементів, кварцове скло, сітали.
3. Оптичні монокристали, для ІЧ-діапазону, для лазерної генерації.
4. Оптичні полікристали (оптична кераміка).
5. Оптичні деталі, етапи виготовлення, контроль параметрів оптичних деталей.
6. Оптичні деталі. Креслення оптичних деталей.
7. Вимоги до матеріалу оптичних деталей. Вимоги до точності виготовлення. Параметри оптичних деталей, що контролюються.
8. Основні етапи обробки: різання, шліфування, механічне полірування, фінішне полірування.
9. Шліфування закріпленим та вільним абразивом. Взаємодія одиничного алмазного зерна з оброблюваною поверхнею при механічній обробці.
10. Полірування: механічне, хіміко-механічне, хімічне.
11. Класифікація абразивних матеріалів та їх основні параметри.
12. Зернистість порошків абразивних матеріалів та їх позначення. Алмазний інструмент. Шліфувальники, полірувальники. Допоміжні матеріали
13. Виготовлення оптичних деталей із скла. Виготовлення заготовок зі скла, відпал.
14. Шліфування зв'язаним та вільним абразивом при виготовленні оптичних деталей із скла. Суспензії для шліфування. Механічне полірування оптичних деталей із скла.
15. Оптичні покриття та з'єднання оптичних деталей. Методи нанесення, властивості. З'єднання оптичних деталей, оптичні клеї, з'єднання методом оптичного контакту.
16. Оптичні кристалічні матеріали та особливості їх механічної обробки. Основні фізико-механічні та фізико-хімічні властивості оптичних кристалічних матеріалів. Кристалографічне орієнтування кристалів. Методи контролю якості кристалів.
17. Механічна обробка кристалів в залежності від мікротвердості. Механічна обробка оптичних кристалічних матеріалів з мікротвердістю більше 106 Па.
18. Порушений приповерхневий шар при механічній обробці. Причини його утворення та поетапне видалення. Структура порушеного приповерхневого шару. Еволюція поверхні в процесі обробки, шорсткість. Структурна досконалість поверхні, криві дифракційного відбиття.
19. Сапфір та виготовлення деталей з сапфіру. Фізичні властивості сапфіру. Градації якості сапфіру. Конструкційний сапфір. Виготовлення оптичних вікон, підкладок з сапфіру.
20. Кристалографічне орієнтування кристалів сапфіру. Різання, шліфування. Механічне полірування, абразивні порошки, пасти.
21. Хіміко-механічне полірування сапфіру, механізм. Полірувальні суспензії.
22. Анізотропія полірування різних кристалографічних площин сапфіру, кутова анізотропія. Одержання підкладок з сапфіру з терасно-ступінчатим рельєфом поверхні.
23. Методи дослідження поверхні. Шорсткість поверхні. Атомно-силова мікроскопія в дослідженні поверхні.

24. Обробка кристалів з мікротвердістю менше 106 Па. Методи контролю основних параметрів. Обробка водорозчинних кристалів.
25. Обробка напівпровідникових матеріалів. Механічне та хіміко-механічне полірування напівпровідникових матеріалів. Безконтактне полірування.
26. Особливості механічної обробки оптичної кераміки.
27. Виготовлення прецизійних елементів для лазерної техніки та вікон спецпризначення. Вимоги до технічних параметрів виробів: якість матеріалу, площинність, перпендикулярність, клин, оптична якість поверхні.
28. Основні етапи технологічного процесу виготовлення прецизійних елементів з сапфіру, гранатів, боратів, магній-алюмінієвої шпінелі. Особливості фінішного етапу прецизійного полірування.

Рекомендована література

Основна література

1. Advances in CMP/Polishing Technologies For The Manufacture Of Electronic Devices, Ed. Toshiro Doi, I.D. Marinescu, Syuhei Kurokawa, Elsevier Inc., 2012, 317 p.
2. Handbook of Lapping and Polishing, Ed. I.D. Marinescu, E. Uhlmann, T.K. Doi, CRC Press, 2007, 492 p.
3. Yiqing Chen, Liangchi Zhang. Polishing of Diamond Materials. Mechanisms, Modeling and Implementation. Springer-Verlag London 2013, 174 p., [DOI 10.1007/978-1-84996-408-1](https://doi.org/10.1007/978-1-84996-408-1).
4. Cutting and Polishing Optical and Electronic Materials, G.W. Fynn, J.A. Powel, IOP Publishing Ltd., 1988, 229 p.
5. Handbook of Ceramic Grinding & Polishing, Ed. I.D. Marinescu, H.K. Tonshoff, Ichiro Inasaki, Elsevier Inc., 2015, 486 p.

Допоміжна література

1. Tribology Of Abrasive Machining Processes, Ed. I.D. Marinescu, W.B. Rowe, B. Dimitrov, Hitoshi Ohmori, Elsevier Inc., 2012, 586 p., [DOI 10.1016/B978-1-4377-3467-6.00001-X](https://doi.org/10.1016/B978-1-4377-3467-6.00001-X).
2. Elena R. Dobrovinskaya, Leonid A. Lytvynov, Valerian Pishchik. Sapphire. Material, Manufacturing, Applications, Springer, 2009, 481 p., [DOI 10.1007/978-0-387-85695-7](https://doi.org/10.1007/978-0-387-85695-7).
3. E.A. Vovk, A.T. Budnikov, M.V. Dobrotvorskaya, S.I. Krivonogov, Danko A.Ya. Mechanism of the Interaction between Al₂O₃ and SiO₂ during the Chemical-Mechanical Polishing of Sapphire with Silicon Dioxide // Journal of Surface Investigation, X-Ray, Synchrotron and Neutron Techniques 6(1) (2012) 115–121.
4. E.A. Vovk. Deagglomeration of aerosil in polishing suspension for chemical-mechanical polishing of sapphire // Functional Materials 22 (1) (2015) 110-115.
5. E.A. Vovk. Chemical-mechanical polishing of sapphire by polishing suspension based on aerosil // Functional Materials 22(2) (2015) 252-257.
6. Hirofumi Suzuki, Mutsumi Okada, Yoshiharu Namba, Tomohiro Goto. Superfinishing of polycrystalline YAG ceramic by nanodiamond slurry, CIRP Annals – Manufacturing Technology 68 (2019) 361-364, [DOI 10.1016/j.cirp.2019.04.062](https://doi.org/10.1016/j.cirp.2019.04.062).

7. Qiufa Luo, Jing Lu, Xipeng Xu, Feng Jiang. Removal mechanism of sapphire substrates (0001, 1120 and 1010) in mechanical planarization machining, *Ceram. Int.* 43(18) (2017) 16178-16184, [DOI 10.1016/j.ceramint.2017.08.194](https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2017.08.194).
8. Xiaolei Shi, Guoshun Pan, Yan Zhou, Li Xu, Chunli Zou, Hua Gong. A study of chemical products formed on sapphire (0001) during chemical–mechanical polishing, *Surface & Coatings Technology* 270 (2015) 206–220.